

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公表番号】特表2003-534427(P2003-534427A)

【公表日】平成15年11月18日(2003.11.18)

【出願番号】特願2001-587044(P2001-587044)

【国際特許分類】

C 0 8 L 101/12 (2006.01)

C 0 8 J 5/18 (2006.01)

C 0 8 K 3/00 (2006.01)

C 0 8 K 5/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/02 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 101/12

C 0 8 J 5/18 C E R

C 0 8 J 5/18 C E Z

C 0 8 K 3/00

C 0 8 K 5/00

C 0 8 L 101/02

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月2日(2008.5.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

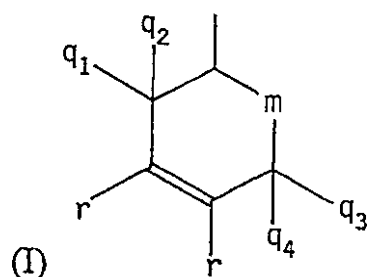
【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 エチレン／ビニルアルコール共重合体（EVOH）と、前記 EVOH 以外の酸素脱ガス重合体と、遷移金属塩との混合物を含む、酸素遮断組成物であって、前記酸素脱ガス重合体が、エチレンバックボーンと、下記構造式 I を有するペンダントシクロアルケニル基を含む、酸素遮断組成物：



（式中、 q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 及び r は独立して、水素、メチル又はエチルから選ばれ； m は $-(CH_2)_n-$ （但し、 n は0～4の整数である）であり；そして r が水素である場合、 q_1 、 q_2 、 q_3 及び q_4 の少なくとも1つはまた、水素である）。

【請求項 2】 酸素遮断性重合体と酸素脱ガス重合体とを含む混合物と、光開始剤と酸化触媒とを含む酸素遮断組成物であって、前記混合物が1％から30％の酸素脱ガス重合体を含み、前記酸素遮断重合体がポリ（エチレン／ビニルアルコール）（EVOH）であり、そして前記酸素脱ガス重合体が本質的にMXD6からなる、酸素遮断組成物。

【請求項 3】 酸素遮断重合体、酸素脱ガス重合体、及び酸化触媒との混合物を含む

活性酸素遮断組成物であって、前記酸素脱ガス重合体がシクロヘキセニルメチルアクリレートの単独重合体又は共重合体である、活性酸素遮断組成物。

【請求項 4】 請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の組成物を含む少なくとも一つの酸素遮断層を含む、包装用（パッケージ用）物品。